

MAUNT®

M10000596

Automatic preparation machine, APM-101, Fujikura



Omschrijving

De Fujikura APM-101 is een volledig geautomatiseerd glasvezel prepareerapparaat met constante betrouwbaarheid en buitengewoon consistente resultaten. Het voert moeiteloos alle vereiste stappen uit voor het gereedmaken van optische vezels voor het lassen. Binnen 23 seconden ontdoet de APM-101 de vezel van zijn buitenste laag zonder kwaliteitsverlies, reinigt de vezel grondig met alcohol om eventuele resten van de coating te verwijderen, en cleavet de vezel altijd loodrecht op de vezelas. Het diamanten mesje zorgt voor consistente cleavekwaliteit. De Fujikura APM-101 is uitgerust met een alcoholcirculatiesysteem dat efficiënt langdurig gebruik mogelijk maakt zonder frequent bijvullen, wat de productiviteit verhoogt. In productie- en industriële automatiseringssystemen biedt de APM-101 ongeëvenaarde efficiëntie: de geautomatiseerde werking zorgt voor ononderbroken lange werktijden, waarbij onderbrekingen voor het schoonmaken van onderdelen en restmateriaalcontainers volledig worden geëlimineerd. Met een ingebouwde druksensor controleert het APM-101 systeem de luchtdruk die vereist is voor kwalitatieve cleaving voordat de handeling begint, waardoor een gebrek aan juiste luchtdruk direct gedetecteerd wordt. Het compacte ontwerp past op diverse werkoppervlakken dankzij zijn kleine formaat. Het gebruik van samengeperste lucht is essentieel voor de werking.

Merk

Fujikura



Technische specificaties

Breedte	170 mm
Diepte	370 mm
Hoogte	120 mm
Gewicht	5.1 kg
Toepasbare vezel	Conventionele silica optische vezel
Vezeldiameter	Cladding diameter: 125 µm, Coating diameter: 250 µm
Coatingmateriaal	UV curable resin
Vezelhouder	FH-100-250 FH-100-250-EV FH-40-250
Cleave lengte	3 tot 10 mm
Cleave hoek	Gewoonlijk 0,5 graden (single mode)
Bedrijfstijd	23 sec
Voeding	AC adapter ADC-15 Invoer AC100 tot 240 V (50 ~ 60 Hz)
Gebruiksomstandigheden	0 tot 40 graden Celsius en 0 tot 95% relatieve vochtigheid (geen dauw)
Opslagcondities	-40 tot 80 graden Celsius en 0 tot 95% relatieve vochtigheid (geen dauw)
Perslucht	0,4MPa (4bar)